有機樹脂材料の光デバイス応用への展開

研究分担者 尾江邦重 大学院 工芸科学研究科 電子システム工学部門 教授

【研究目的】

近年、光通信の分野では、安価で透明性、加工性に優れた有機樹脂材料による光部品の開発が注目さ れている。我々は、この有機樹脂材料を光通信用の光デバイスに展開し、広く応用の可能性を探る研究 を行っている。第一歩として、感光性透明ポリイミド樹脂を用いた自己形成導波路作製技術について検 討し、光ファイバと導波路を接続する新しい光接続技術を研究・開発する。さらに、有機色素を用いた 光集積回路用光増幅器作製の可能性を探り、無機材料では不可能であった高機能光デバイスを有機樹脂 材料で実現すべく、広く有機樹脂材料の可能性を追求することを目的としている。

【研究成果】

1. 自己形成導波路

感光性透明ポリイミド樹脂に光ファイバを伝搬してきた光を照射すると、樹脂は照射強度の強い光軸 上から選択的に感光し屈折率に勾配が生じる。そして、これにより光閉じ込め効果が誘発され光が伝搬 し、伝搬した光はさらにその先の樹脂を感光して、伝搬光自らが導波路を形成しながら進む。これは自 己形成導波路と呼ばれている。本研究はこの現象を用いて感光性透明ポリイミド中に自己形成光導波路 を作製し、光ファイバと導波路を接続する新しい光接続技術を研究・開発することを目的としている。

1.1.緒言

近年、光デバイスのラフアライメント技術として、感光性樹脂を用いた自己形成導波路が注目されて いる。本来、光ファイバからの出射光は回折もしくは光ファイバの開口数(NA:Numerical Aperture)に 応じて拡がって伝搬する。これを光重合性ポリマーである感光性樹脂に埋め込み,出射を行った場合, 出射光強度の大きい光軸上から光重合によりポリマーの屈折率が増加する。結果として,出射光は感光 部分である光軸上に閉じ込められ,さらに照射を続けることによってその先の部分が感光し,出射光に 光軸上の先の部分まで閉じ込められる。このように出射光自身が導波路を形成しながら伝搬していくこ とから自己形成導波路と呼ばれている[1,2]。我々は、新規の感光性ポリイミド(PSPI)を用いること により、デバイス応用に重要な全固体型の自己形成導波路を簡易なプロセスで作製できることを示して きた。ここでは、その形成メカニズム、PSPI 材料の光学特性と導波路自己形成の関係、長尺化のための 手法、単一モード動作可能な自己形成導波路作製等について行ってきた研究について述べ、この感光性 ポリイミドを用いた全固体型の自己形成導波路の光アライメント技術としての有用性を示す。

1.2. 感光性ポリイミドによる自己形成導波路の作製

1.2.1 PSPIの特徴

本研究で使っている PSPI は、レジストの機能を持った光導波路用ポリイミドとして開発され、光導 波路として耐熱性に富み(ガラス転移温度330度以上)、低損失伝搬特性を示す(0.4 dB/cm)[3]。 また、この PSPI は光が当たった部分の屈折率が当たらない部分のそれに比べて増加するというホトブ リーチィング効果を持つ。自己形成導波路作製は、この現象を利用して光ファイバの一端を PSPI で埋 め込み、他端からレーザ光を照射して、レーザ光の当たった部分(コア部)の屈折率を上昇させ、3次 元の導波路を形成していく。全固体型の自己形成導波路を得るためには、レーザ光の当たらないクラッ ド部分の屈折率をコア部に比べて、小さく保ったまま固体化する必要があるが、この PSPI は熱を加え るサーモセッテング処理によりこれが可能となり、簡単なプロセスで低コストの光モジュール作製を実 現する可能性を有している。

1.2.2 自己形成導波路の作製

この PSPI はフッ素化ポリアミド酸(fluorinated polyamic acid) と光増感剤としての ジヒドロピリ ジン誘導体 {(1,4)-dihydropyridine} からできている。PSPI の自己形成導波路を作製するプロセスは、

PSPIを光ファイバが置かれているガラス板上に被せ、100度で15 分間プリベークする。その後、488-nm線のアルゴンレーザ光を光フ ァイバ他端から入れる。図1は、このレーザ光による露光中の様子 を示したものである。この光ファイバはコア系50µmの屈折率分布 型多モードファイバであり、レーザ光パワーは1 mWである。また、 ファイバからのレーザ出力光のニアフィールドはガウス分布を示す。 図1(a)(b)は、光増感剤なしのPSPIにレーザ光を照射したときの 直後と5分後の状態を示す。どちらの場合もレーザ光は広がったま まで、光閉じ込め効果のある導波路は形成されていない。これに対 し光増感剤のある PSPIでは、照射直後からレーザ光放射角が狭窄化 されており{図1(c)}、5分後には直径一定のコアを持つ自己形成 導波路が出来ていることが分かる

{図1(d)}。この形成メカニズムとしては、PSPI にレーザ光が当たった時、光増感剤があるとそれが触媒のような役割を果たし、その部分のイミド化を促進すると共に、その化学反応により PSPI の光学的性質を変化させ、屈折率が上昇するものと考えている。この屈折

率差は、この状態でも、書きこみ用の 488-nm 線のアルゴンレーザ光に対しては、光閉じ込めに十分な 大きな値であるが、光通信に使用する赤外波長域ではさほど大きくない。PSPI をさらに 180 度 20 分間

のポストベークを施すことにより、赤外波長域で十分な閉 じ込めが得られる程屈折率差が大きくなる。このサーモセ ッテング処理により全固体化の導波路形成が可能になる。

1.2.3 自己形成導波路を用いたファイバ間接続

この自己形成導波路技術を使って、2本のマルチモード ファイバ間の接続損失低減化を試みた。V みぞを持つ石英 基板上に2本のマルチモードファイバを少し離して置き、 そのままの状態と自己形成導波路を作った状態での挿入損 失の変化を見た。図2は、3 種類のファイバ間ギャップに 対する挿入損失を示したものであるが、いずれの場合でも ポストベーク後のギャップ挿入損失は、空気のギャップのま



図1 多モードファイバからポリイミドへの Ar レーザ光出射の様子 (a)光増感剤な し・照射直後 (b)光増感剤なし・照射 5 分 後 (c)PSPI への照射直後 (d) PSPI への 照射 5 分後



図2 2 本の多モードファイバ間のギャップ挿 入損失

まに比べて大きく減少していることがわかる。プリベークの状態でも、損失がかなり減っているのは、 屈折率が増加したことによるマッチングオイルのような効果によるものである。このように、このレー ザ光による自己形成導波路は、ファイバ間の接続損失の低減化に有望である[4]。

1.3. 自己形成導波路の長尺化

PSPI 自己形成導波路のデバイス応用の可能性 を広げるためには、自己形成導波路長を拡長す る必要がある。そのために、導波路書き込みレ ーザ波長や感光剤濃度を変えることにより長尺 化を試みたが,材料そのものによる書き込み光 の吸収が大きく,劇的な変化は見られなかった。 そこで、感光剤そのものに注目し,PSPIの感光 剤であるジヒドロピリジン誘導体(DHPs)の光化 学反応について検討し、種々のDHPsを持つPSPI の光吸収特性を調べた。図3は、DHP-AとDHP-B の2種類の感光剤を持つPSPIの吸収係数の 488-nm アルゴンレーザ光照射量に対する変化を 示している。DHP-Aを持つPSPIでは、露光前の 最初の吸収係数は ~12 cm⁻¹であったが、光照射 により吸収係数は露光量と共に単調増加し、~



17 cm⁻¹に達した。この吸収係数から推測される 488-nm アルゴンレーザ光の浸入長は~580µm であり、 この材料を用いた自己形成導波路長にほぼ等しい。より長い自己形成導波路を得るためには、露光によ り吸収係数が小さくなる光化学反応を示す材料を必要とすることがわかる。図 3 中の DHP-B 感光剤を持 つ PSPI はこの目的で開発されたものであり、露光前の最初の吸収係数は ~17 cm⁻¹と大きな値であった が、光照射により吸収係数は露光量と共に単調減少していることが分かる。この性質は長い自己形成導 波路を作製するには好ましいことであり、これにより~2 mm 以上の自己形成導波路を作製できることを 確認した[5]。

1.4. 自己形成導波路の単一モード動作

この自己形成導波路を単一モード動作可能にすることは実用上非常 に重要であるが、通常の光通信用単一モードファイバ(SMF)では書き 込み光波長で高次モードが発生し、自己形成導波路作製のために理想的 なガウシアン形状を持った光強度分布が得られないという問題点があ る。これを解決するため、高次モードを制御して自己形成導波路のコア 径を一定とする簡便な作製手法を考えた。PSPI ワニスを用いた自己形 成導波路作製過程の様子を図4に示す。コア径 9µmの通常の光通信用 単一モードファイバ(9µm-SMF)を用いた場合[図4(a)]、露光に用い た 488nm のレーザ光はマルチモード動作をする。そのため、挿入図のニ アフィールドパターン(NFP)に示すように、ファイバ端での光強度分 布はスペックルなものになる。高次モードの存在は書きこみ光の自己閉



(a)3µm-SMF 未使用時



(b)3µm-SMF 使用時

図4 光通信用単一モードファイバ (SMF)から PSPI への Ar レーザ 光照射時の様子 じ込め効果を妨げ、作製される自己形成導波路はある広がり角を持ったテーパ状のものとなってしまう。 この問題を解決するために、コア径 3 μ m の 488nm で単一モード伝搬するファイバ(3 μ m-SMF)を導入 した。3 μ m-SMF と 9 μ m-SMF を市販の FC コネクタでカップリングすることにより、9 μ m-SMF 端面での NFP は、理想的なガウシアン形状のパワー分布を示した[図 4 (b)]。写真に示すように、この手法により 自己形成導波路のコア形状を微細でしかも均一なものとすることができた。

この方法で作製した自己形成導波路に 1.55 µm の赤外光を導入したところ、自己形成導波路端面から のNFP も単一モードであることが確認できた。また、出射光の遠視野分布の広がり角より見積もられた 実効的なコア径は 8.3 µm と SMF のコア径と同程度であった[6]。これらのことより、本研究の自己形成 導波路新規作製手法は単一モード導波路間の接続に非常に有効であると思われる。また本手法では、9 µm-SMF へのレーザ光導入に市販のFC コネクタを使用できるため、再現性良く単一モード自己形成導波 路を作製することができる。

1.5. 自己形成導波路研究のまとめ

感光性ポリイミドを用いて全固体型の自己形成導波路を簡易なプロセスで作製する我々の研究について、レーザ光による導波路自己形成の原理、長尺化のための手法、シングルモード動作可能な自己形 成導波路作製等、今まで行ってきた研究成果について述べた。この技術は、現在光通信技術の中でボト ルネックとなっているモジュール内の光接続に対して新しい展開を与えるものと考えられ、今後の進展 が期待される。

2. 有機樹脂材料の光増幅器への応用

2.1. 緒言

光通信では,光ファイバを伝搬中に光が減衰し,受信端では光検出器の感度限界に近い微弱光になっている。そのため,中継器として光増幅器を用意することが望まれる。

現在,実用化あるいは研究開発されている光増幅器には,大きく分けて光ファイバ増幅器と半導体光 増幅器がある。前者には希土類添加光ファイバ増幅器とラマン増幅器がある。特に,希土類添加光ファ イバ増幅器のなかでも,エルビウム(Er)を添加したエルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA)では, 光ファイバの最低損失帯である 1.55 µm 帯で光増幅特性を示し,雑音特性も優れているため,光通信 システムで現在広く用いられている。しかし希土類を添加する場合,濃度消光が大きいという欠点があ り,それによりファイバ中に低濃度にしか分散できないため距離を長くすることで利得を稼ぐ必要があ り,集積化は困難である。実際,EDFAではデバイスサイズが数~数十mと大きくなってしまう。一方, 半導体光増幅器では,端面の無反射コート処理が必要であり,それにかかるコストが高いという問題と, ファイバや石英導波路との屈折率整合性が悪いためパッケージングが困難という問題点がある。以上の ことから,現在のところ,集積型の光増幅器は未だ実用化に至っていない。しかし,光通信網の拡大や 光情報伝達分野の多様化に伴う次世代の光エレクトロニクス技術として集積型デバイスが重要となる ため,これらに変わる光増幅デバイスが必要と考えられる。

そこで本研究では、活性媒体としては新しい材料である有機色素材料に注目し、集積型の光増幅デバ イスの実現を目指す。有機色素材料はポリマーなどの母材に高濃度で分散可能、発光波長の調整が可能、 比較的低温でデバイス作製可能という特徴を持ち、これを用いることにより安価で高利得な集積型光増 幅器が実現可能と考えられる。まず、材料及び構造の側面から集積型光増幅デバイス実現に向けたアプ

- 37 -

ローチを行うために, 色素材料の光学特性と光 増幅特性の関係を求めた。そして導波路型光利 得構造の作製を行い, デバイス型の光増幅効果 の検証を行った。

2.2. 導波路サンプルの製作

市販で入手が可能である有機色素材料を用い ることにより利得評価を行った。有機色素材料 は

4-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadieny l]-1-ethylquinolinium perchlorate(NK-2807) である。また,別の色素 2-[7-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-y lidine)

-1,3,5-heptatrienyl]-1,3,3-trimethyl-3Hindolium iodide (NK-125) も比較対照のため
に使用した。 薄膜サンプルは、利得の濃度依
存性を調べるためスピンコート条件を 2000
rpm 10 sec に固定し, 色素ドープ濃度を 0.2
- 2.0-wt%と変えて作製した。完成した薄膜サンプルの膜厚は< 2 μm であった。

次に、チャネル導波路型サンプルを作製した。 RIE により作製した石英基板をチャネル導波 路型サンプルとして用いた。導波路幅は順に、 1,2,5,10,20,50,100 µm であり、それらのパタ ーン溝の深さはすべて 10 µm である。この基 板に対して、色素分散ポリマー薄膜を形成し、 チャネル導波型サンプルを作製した。このサ ンプルの導波路幅 100 µm 部にポンプ光(波 長 565 nm)を照射すると、導波路幅 100 µm 部にのみポンプ光照射による発光が見られ、 導波路部に光が閉じ込められて導波してい る様子が確認できた。

2.3. 光增幅利得評価

まず,薄膜サンプルを用いて ASE 閾値測定 を行った。発光強度の励起強度依存性のグラ フを図5に示す。ここでいう発光強度とは, 励起強度が最大の条件下で ASE スペクトル がピークを示す波長 800 nmにおける発光強



図 5. 発光強度の励起強度依存性 (薄膜サンプル,色素ドープ濃度 1.0-wt%, 膜厚 1.4 μm, ポンプ光長 565 nm,励起長 5 mm)



図6.NK-2807 発光強度の励起長依存性 (薄膜サンプル,色素ドープ濃度 1.0-wt%,膜厚 1.4 µm, ポンプ光長 565 nm,ポンプ光強度 73.1 µJ/cm²)





(薄膜サンプル,膜厚 1.4 μm,ポンプ光波長 565 nm, ポンプ光強度 73.1 μJ/cm²)

度を指している。ポンプ光強度が弱いうちはポンプ光強度に比例して発光強度も増加するが、あるポン プ光強度以上になると、ポンプ光強度に対して発光強度が非線形に増加することが分かる。この境界の ポンプ光強度が ASE 閾値である。図5より、NK-125の ASE 閾値は 130 μJ/cm²、NK-2807の ASE 閾 値は 12.5 μJ/cm² とそれぞれ得られた。したがって、今回使用した色素 NK-2807 では、NK-125 よりも ASE 閾値が~1/10 に低減できたことになる。

続いて NK-2807 の光増幅利得を測定した。波長 790nm における発光強度の励起長依存性のグラフを 描くと図 6 のようになった。これによって濃度 1.0-wt%, 0.2-wt%のときの利得係数はそれぞれ 2.9 mm⁻¹, 1.4 mm⁻¹, と得られた。しかし,ここで注意する点として,濃度 1.0-wt%の場合励起長が~3 mm 以上 になるとフィッティング曲線から実測値がはずれていっていることが分かる。これは利得飽和の存在を 示している。同様の測定を,色素ドープ濃度を変えた薄膜サンプルを用いて行うことで、利得の濃度依 存性を調べた。その結果を図 7 に示す。利得は濃度に線形比例して増加するはずであるが、増加の割合 はそれよりも小さくなっている。この結果は NK-2807 を用いた場合でも濃度消光が現われることを示 している。しかし、ドープ濃度 0.5-wt%のとき利得係数は 2.2 mm⁻¹であり、既報の材料に比べ、十分 に大きい利得を有していると言うことができる(7)。

2.4. 導波路構造と光増幅利得

有機色素材料を用いた光増幅効果をデバイス 応用するためには,材料だけでなく導波路構造 も重要である。この節では,導波路構造が利得 係数に及ぼす影響を調べ,チャネル型光導波構 造の作製を行う。続いてチャネル導波路構造に 対して色素分散ポリマーを充填し,光増幅特性 評価を行った。

チャネル導波路構造における表面ポンプによ る閾値は 41.6 μJ/cm²と得られた。この値は,薄 膜サンプルを用いた場合の表面ポンプによる ASE 閾値 12.5 μJ/cm²より大きかった。原因と しては,ポンプ光をストライプ状に照射する際

に, 絞ることができる限界の幅が ~200 μ m 程度であり, 一部がロス となっているため ASE 閾値が増加 したと考えられる。 しかし、チ ャネル導波路構造の場合の ASE 閾 値も, NK-125 の ASE 閾値 130 μ J/cm² の~1/3 程度に低減できて おり, 低閾値化できているとも言 える。ポンプ光の照射方法を改善 することにより, ASE 閾値はさら に低減できるものと考えられる。

デバイス型の光増幅として,表







面ポンプではなくサンプル端面からポンプを行う導波型ポンプ法を用いることによる ASE 閾値測定を 行った。まず色素ドープ濃度 1.0-wt%, 膜厚 4 μm の薄膜サンプルを用いて, ASE 閾値測定を行った。 ポンプ光波長は 565,540,520 nm に設定して照射を行った。そのときの 565 nm 光源励起の強度依存性 を図 8 に示す。同じ条件である波長 565 nm を使用した場合の表面ポンプ/導波型ポンプの ASE 閾値を 比較してみる。導波型ポンプの閾値は 14.5 μJ であるのに対し, 図 5 より表面ポンプの場合の ASE 閾 値は 12.5 μJ/cm² であり, トータルパワーに書き直すと 1.88 μJ である。導波型ポンプの閾値の方が大 きいが、結合効率を改善する方法を考えることで,導波型ポンプの適用により, ASE 閾値をさらに低減 できる可能性がある。

2.5. 導波路入力光の光増幅

チャネル型光利得構造を用いることにより,外部から赤外の信号光をチャネル端面から入力し,表面 ポンプ(波長 565nm)による入力光の増幅効果を検証した。

この測定結果を図9に示す。凡例の「seed」とは種光,つまり入力信号光の導波光を指し,「pump」 とはポンプ光照射による発光を指す。信号光のみ入力した場合の光強度(seed)に対して,ポンプ光と 信号光を同時に入力した場合の光強度(seed+pump)が大きくなっていれば,増幅が起こったことにな るが,増幅率を計算するためにはポンプ光のみを照射した場合の発光強度(pump)を差し引いておく 必要があるため,図中の seed と 「(seed + pump) - pump」のスペクトルを比較する必要がある。こ の結果,確かに入力光の増幅が起きていることが確認できる。

今回用いた実験系では、ポンプ光にはパルス光源を、入力信号光には CW 光源を用いたため、この結果を用いて入力光増幅率を求めることができなかったが、有機色素材料を用いた入力信号光の増幅に初めて成功した。

2.6. 光増幅器のまとめ

本研究では、まず近距離通信で重要である近赤外に発光帯を持つ有機色素材料 NK-2807 を活性媒体と して赤外光の増幅現象を詳細に調べ、ASE 発光の低閾値化を実現する材料特性を検討した。また、利得 と導波構造の関係性を調べることを目的として、薄膜スラブ構造とチャネル導波路構造の2つの導波路 構造を用いて増幅効果の検証を行った。そして、デバイス型の光増幅効果の検証を、チャネル導波路構 造を適用することにより行った。

さらに有機樹脂材料の優位性を検証すべく、これを用いた安価で高利得な集積型光増幅器への応用を念 頭に、光LANに用いられている 0.85 µ m波長帯での光増幅実現に向けて研究を進めた。この波長帯で 優れた増幅特性を持つ NK2807 有機材料を用いて、従来の材料より一桁小さい誘導放出閾値を実現した。

【今後の展開と見通し】

得られた成果を基に、自己形成導波路の実際の光回路実装への適用を考えた問題点の抽出とその解決 策を考えていく。また、安価で透明であり、加工性に優れたこれらの樹脂材料の特徴を生かした光機能 素子創製への可能性を追求していく。また、光集積回路用光増幅デバイスの研究では、そのデバイス化 研究を進め、波長 0.85µmでの信号光増幅を実現・検証すると共に、光通信の本命である波長 1.3µm 帯の光増幅のため、新色素を用いた薄膜導波路の検討、光増幅特性の把握を行っていく。さらに、自己 形成導波路技術を光増幅器デバイス研究に取り込み、挿入損失の小さい接続による光増幅器を開発して いく。

参考文献

- Kagami, M. Yamashita, T. and Ito, H.: Light-induced self-written three-dimensional optical waveguide, Appl. Phys. Lett., 79, 8, (2001),1079.
- (2) Shoji, S. Kawata, S. Sukhorukov, A. A. and Kivshar, Y. S.:Self-written waveguides in photopolymerizable resins," *Opt. Lett.* Vol. 27, pp. 185-187, Feb. 2002.
- (3) Mune, K. Naito, R. Fukuoka, T. Mochizuki, A. Matsumoto, K. Yurt, N. Meredith, G. Jabbour, G. and Peyghambarian, N.:Fabrication of low loss optical waveguides using a novel photosensitive polyimide, *SPIE* 4997(2003),103.
- (4) Yamashita, K. Hashimoto, T. Oe, K. Mune, K. Naito, R. and Mochizuki, A.:Self-written waveguide structure in photosensitive polyimide resin fabricated by exposure and thermosetting process, IEEE Photonics Technol. Lett. 16, 3, (2004), 801.
- (5) Yamashita, K. Kuro, T. Oe, K. Mune, K. Tagawa, K. Naitou, R. and Mochizuki, A.:Fabrication of self-written waveguide in photosensitive polyimide resin by controlling photochemical reaction of photosensitizer, Appl. Phys. Lett., 85, 18, (2004), 3962.
- (6) Yamashita, K. Kuro, T. Oe, K. Mune, K. Hikita, T. and Mochizuki, A., :Propagation-mode-controlled fabrication of self-written waveguide in photosensitive polyimide for singlemode operation, IEEE Photonics Technol. Lett. 17, 4, (2005), 786.
- (7) T. Kobayashi, J-B. Savatier, G. Jordan, W. J. Blau, Y. Suzuki and T. Kaino: "Near-infrared laser emission from luminescent plastic waveguides", Appl. Phys. Lett., Vol. 85, pp185-187, (2004)